以TiO₂光觸媒催化程序

處理氣相丙酮污染物反應行為之研究

續洋¹ 曾焜煜² 吳昌晏³

摘要

本研究係利用紫外線/光觸媒(photocatalyst, TiO₂)程序結合套管式環狀光反應器處理含氣相丙酮氣 體,光觸媒的選擇係以Degusaa所生產的P-25 二氧化鈦為主,光觸媒薄膜製備方式為含浸法。本研究 探討反應系統中反應物初始濃度、紫外線光強度、反應滯留時間、氣體含氧量等因子對反應物去除率 及礦化程度之影響。以紫外線/二氧化鈦光觸媒程序處理含氣相丙酮氣體,結果顯示,在低初始濃度時, 反應速率隨著初始濃度的增加而增加,當反應物初始濃度大於一定值後,反應速率隨著初始濃度增加 而減少,有一最佳初始濃度值;隨著紫外光光強度提高,去除率和礦化率呈現增高的趨勢,但在高光 強度時,有逐漸減緩的趨勢;滯留時間增加,去除及礦化效果也隨之愈高;當氣體含氧量較低時,反 應速率會隨著氣體含氧量增加而增加,但在高含氧量時,則趨於穩定,不再增加。

關鍵字:紫外線/光觸媒、二氧化鈦

一、前言

一般處理含揮發性有機物(Volatile Organic Compounds, VOCs)廢氣的方法包含了物理化學、 生物法將VOCs由一相轉換至另一相或利用大量 能量將其破壞。近年來已有許多學者致力於使用 高級氧化程序(AOP)中的紫外線/光觸媒程序,此 方法是利用高能量的紫外線將光觸媒激發形成具 高氧化能力之中間產物(如氫氧自由基等),來攻擊 污染物,使得分解速率顯著地加快,在適當的操 作條件下,更可將VOCs分解並氧化成最終產物 (二氧化碳及水)。紫外線/光觸媒此程序中常用的 光觸媒包括金屬氧化物及硫化物半導體,如 ZnO、WO3、CdS及TiO2等,此半導體在共價帶及 傳導帶有適當的能帶間隙(1~3 ev)。因TiO2具有光 活性強、穩定性佳、便宜、不易腐蝕、無毒性及 可吸收紫外光,而被認為光觸媒的標竿。

1.國立台灣科技大學化工系教授
 2.國立台灣科技大學化工系碩士

本研究係以連續式紫外線/光觸媒程序配合套 管式環狀光反應器處理含揮發性有機物氣體,標 的污染物則為丙酮,所選用之光觸媒為二氧化鈦 (TiO₂),探討在處理丙酮之可行性及效果。本研究 分別針對各影響紫外線/二氧化鈦程序之因子(反 應物初始濃度、紫外線光強度、滯留時間、氣體 含氧量)進行探討,改變不同的操作條件進行研 究。

二、實驗設備與方法

1. 實驗設備

研究的實驗裝置如圖 1 所示,主要由流動式 環狀光反應器、UV燈管、變壓器、穩壓器、循環 式恆溫水槽、有機物氣體供應單元、濕度氣體供 應單元、二氧化碳分析檢測裝置及流量監控設備 組合而成。流動式環狀光反應器包括石英套管及 不鏽鋼外筒,石英套管內徑 2.6 公分,外徑 3 公 分,將二氧化鈦披覆於石英管外部,燈管則置於 石英管內部。不鏽鋼外筒為圓柱形容器,內徑 15.3 公分,長 23 公分,進出口端各有一取樣口,扣除 中間燈管所佔體積,容積約為 4066cm³,外部纏加 熱帶配合溫度控制系統以固定反應溫度。 UV燈光 源為GTE F15T8/BLB,15W,輻射輸出之波長主要 分佈在 360~370nm間。



圖1 實驗裝置圖

2. 實驗方法

氣相丙酮的來源是以一定流速之氣體通入含 丙酮溶劑之恆溫瓶,另一股氣體通入裝有純水之 恆溫瓶中,以控制實驗所需濕度。調整流量計設 定氣相丙酮之反應時間、相對濕度,反應器溫度 固定控制在 37℃,反應器內壓力為1 大氣壓。待 系統達到穩定後,打開紫外光燈照射,待系統再 次穩定後紀錄NDIR之mv值讀數,並以氣密針自取 樣口取 1ml氣體,直接注入氣體層析儀 (GC/FID) 中,分析丙酮氣體濃度。

3. TiO2光觸媒製備

TiO₂光觸媒製備採用含浸法:(1)先取 0.7 升 超純水放入 2 升Pyrex玻璃燒杯中。(2)加入 200 g 二氧化鈦(Degussa P-25)於純水中,以磁石攪拌器 連續攪拌。(3)秤取 0.02 g分散劑(二辛基磺酸鈉), 使分散劑溶解於熱水後,加到二氧化鈦溶液中, 並加超純水至總重 1000 g。(4)將配置好的二氧化 鈦懸浮液以超音波震盪裝置連續震盪 24 小時。(5) 以等速將石英管浸入二氧化鈦懸浮液中,停留 1 分鐘後,等速將石英管抽離液面,並在空氣中自 然風乾。(6)重複步驟(5)直到達要求的披覆厚度。

三、結果與討論

一般紫外線/二氧化鈦程序之反應速率、去除

率及礦化率主要會受到反應物初始濃度、紫外光 光強度、滞留時間及氣體含氧量等因子所影響。 本節將針對這些影響因子的效應進行探討。

1. 反應物初始濃度效應

利用連續式紫外光/光觸媒程序處理含揮發性 有機污染物氣體,反應效果及速率均會受到污染 物初始濃度影響,反應速率遵循 Langmuir-Hinshelwood反應速率式,當污染物初始 濃度較低時,反應速率隨著反應物初始濃度增加 而增加而趨近一階反應;當反應物初始濃度在較 高時,反應速率則呈現一穩定值,此時的反應速 率趨近於零階反應。反應物初始濃度效應實驗之 操作條件分別為, 365nm UV 光強度 3.09 mW/cm²、壓力 1atm、反應器溫度 35℃、相度濕 度 10%、氣體總流量 200 ml/min、滯留時間 20.3 分鐘,攜帶空氣為乾空氣,分別控制丙酮的初始 濃度為 80、106、154、191、224、286、347ppmv, 其去除和礦化的情形如圖 2 所示。圖 2 顯示在丙 酮初始濃度為 80 ppmv時,去除率可達 40%;隨 著初始濃度增加至 347 ppmv, 去除率下降至約 20 %;而礦化率(CO2產生率)也是隨著丙酮初始濃度 增加而降低,此現象可由吸附的觀點加以探討。 由於在實驗中披覆於石英管上的觸媒數量是固定 的,因此在單位間內觸媒提供給丙酮的活性吸附 位置是有限的[1],所以提高丙酮初始濃度並不代 表丙酮在觸媒表面上的吸附量也是相對的增加, 由於反應進行是丙酮先經由擴散吸附之後在光觸 媒表面發生氧化反應,因此在吸附控制的條件 下,反應所能去除的效果有限,轉化的效果亦同 樣有限。



圖2 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,反應物 種隨初始濃度變化之情形

2. 紫外線光強度效應

在異相光催化反應中,紫外光光強度會直接 影響光觸媒表面上電子-電洞對激發的情形,而影 響到氫氧自由基的生成,進而影響反應之進行。 在UV/TiO2程序處理揮發性有機污染物的過程 中,光強度的影響主要為激發光觸媒反應機制, 因此在本實驗以連續式反應器處理氣相丙酮氣體 之光強度效應部分,是以 80ppmv 的初始濃度、 操作壓力為 1atm、反應器溫度 35℃、相對濕度為 10% 及氣體總流量為 200 ml/min的操作條件下, 分別變化光強度為 1.96、2.46、2.48、3.09、3.61 及 4.08 mW/cm², 氣相丙酮的去除率和礦化率如圖 3所示。實驗結果顯示丙酮的去除率和礦化率隨著 紫外光光強度提高而呈現增高的趨勢,此原因是 在提高紫外光光强度可以使光觸媒受光照射激發 的程度變大,造成電子-電洞對生成速度加快,進 而加速氫氧自由基的生成速率以利氧化反應的發 生;但在高光強度(大於 3.61 mW/cm²)時,反應去 除及礦化效果有逐漸減緩的趨勢,此結果可由電 子-電洞對生成及重組方面來加以探討,可分為以 下雨點:

(1)在紫外光光強度過大的情形下,光觸媒受紫外光激發所產生的電子-電洞對數目過多,而電子電洞發生重組的機率也因此相對提高,導致電荷捕捉及傳送的能力受到限制,因此電荷重組開始主導反應之進行,而使光的使用效率不佳,反應去除及礦化效果逐漸趨於平緩。

(2)由於本研究是使用固定膜光反應器,將所 製備好的二氧化鈦光觸媒均匀披覆於石英管上, 形成一層二氧化鈦薄膜,因此石英管外表面面積 亦即為二氧化鈦之活性面積,故在活性位置數量 固定的情況下,所能吸附的反應物數量就有限, 且加上經由光激發所產生的電子-電洞對數量亦 有限,因此增加紫外光光強度對反應並無顯著的 促進效果,同時也會降低紫外光的使用效率。

3. 滞留時間效應

滞留時間的影響在於混合氣體與光觸媒之間 的接觸反應效率,一般而言,滞留時間愈長,反 應物和光觸媒的接觸時間也愈長,而使反應效果 愈佳[2]。本研究以初始濃度為80ppmv丙酮氣體進 行反應,在操作壓力為1 atm、相對濕度10%、紫 外光光強度為3.09 mW/cm²的操作條件下,以乾空 氣為攜帶氣體,分別控制氣體總流量為200、250、 300、350、400 及 450 ml/min,其滯留時間分別為 7.6、6.1、5.1、4.4、3.8 及 3.4 min,其去除及礦化 的情形如圖 4 所示。實驗結果發現,隨著滯留時 間增加,丙酮的去除及礦化效果也隨之愈高,當 在滯留時間為 7.6min時,去除率約可達 40%。



圖3 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,反應物種

隨紫外光光強度變化之情形



圖4 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,反應物種 隨滯留時間變化之情形

4. 氣體含氧量效應

在紫外光/光觸媒的反應機制中,氧氣在反應 中扮演重大的影響因子,因為氧氣會與光激發電 子進行一連串的連鎖反應而生成具有高氧化力的 過氧化氫自由基(•H₂O₂)及氫氧自由基(•OH), 對於有機物質氧化過程具有促進的作用。本研究 以初始濃度為 80ppmv的丙酮氣體進行反應,在操 作壓力為 1atm、紫外光光強度為 3.09 mW/cm²、 相度濕度為 10%、氣體總流量為 200 ml/min的操 作條件下,以氮氣與氧氣的混和氣為攜帶氣體, 分別控制氣體中的含氧量為 0、5,000、15,000、 25,000、35,000、45,000、50,000、100,000、150,000、 反應,其去除及礦化的情形如圖 5 所示;實驗結 果顯示,當氣體含氧量為零時,丙酮的去除幾乎 為零,在漸漸提高氣體中的含氧濃度時,丙酮的 去除和礦化也隨之增加,但是當含氧量到達一定 值(200,000ppmv)時,丙酮的去除並無明顯的變化。 當氧分子吸附二氧化鈦時,氧分子和導電帶中被 光所激發的電子反應形成超氧離子(superoxide raical, $\cdot O_2^-$),降低電子電洞再結合的機率。而當 超氧離子和水分子反應後,可生成反應所需的氫 氧自由基,因而增加反應物的去除[3]。其反應如 下:

 $TiO_2 + hv \to TiO_2\left(e_{cb}^- + h_{vb}^+\right) \tag{1}$

 $O_2 + e_{cb}^- \to O_2^- \tag{2}$

 $2H_2O + O_2^- \rightarrow 2OH + OH^- + O_2 \tag{3}$

因此,氣體含氧量增加,丙酮的去除和礦化 也隨之增加;但隨著含氧量到達200,000ppmv時, 氧含量的增加對於反應的進行並無明顯的促進效 果。因為紫外光光強度和光觸媒活性位置數量均 固定的條件之下,經由光激發所產生的電子-電洞 對亦有限,當電子完全被氧分子捕捉時,所能生 成的氧氧自由基有限。由於吸附於光觸媒表面上 的氧氣是屬於化學吸附,使得在高含氧量時,吸 附於光觸媒表面上的氧會達到飽和;且氧分子的 吸附位置和反應物與水分子所佔據的活性位置不 同,並不會和反應物產生競爭吸附的現象,因此 能夠參與反應的氧分子亦有限[4]。使得反應系統 中過多的氧分子已無法吸附於光觸媒表面上,因 而提高含氧量並無助於反應。



圖5 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,反應物種 隨氣體含氧量變化之情形

5. 動力模式推導

大部分的文獻中,對於以 365nm紫外光波長為 光源之UV/TiO2程序處理氣相有機污染物反應速率 式,大部分學者都是用 Langmuir-Hinshelwood (L-H)速率式加以探討[5],並假設反應速率和 光強度之指數次方成正比,因此,再固定濕度等 條件之下修正L-H速率表示:

$$-r_{A} = -\frac{dC_{A}}{dt} = k_{0}I^{n} \left(\frac{K_{A}C_{A}}{1+K_{A}C_{A}}\right) \left(\frac{K_{O_{2}}C_{O_{2}}}{1+K_{O_{2}}C_{O_{2}}}\right)$$
(4)

其中,

$$C_A$$
 · 反應物濃度 (ppmv)
 C_{O_2} :氧分子物濃度 (ppmv)
 k_0 :反應速率常數 (ppmv⁻¹cm⁻²sec⁻¹)
 K_A :反應物吸附平衡常數 (ppmv⁻¹)
 K_{O_2} :氧分子吸附平衡常數 (ppmv⁻¹)
 I :紫外線光強度 (mW/cm²)
 n :紫外線光強度階數 (ppmv)

將上式經由線性回歸計算可求得丙酮吸附平衡常 數 (K_A =0.00683 ppmv⁻¹)、氧分子吸附平衡常數 (K_{o_2} =2.12×10⁻⁴ ppmv⁻¹)、反應速率常數 (k_0 =0.0534 ppmv⁻¹cm⁻²sec⁻¹)、紫外線光強度階數 (n=0.622)。然而,由推導出來的紫外光光強度 階數n為 0.622,這和大部分的學者認為紫外光光 強度階數應在 0.5~1之間吻合,當紫外光光強度 階數為 1 時,被光激發生成的電子-電洞對在反應 進行中被消耗的速率比電子電洞在結合的速率快 許多,然而當紫外光光強度階數為 0.5,此時反應 的進行是由電子電洞再結合所主導[6]。

歸納以上實驗之計算結果,在本研究中以連續式環狀反應器進行氣相丙酮光催化分解反應 時,反應行為可利用雙位置 Langmuir-Hihshelwood動力模式加以描述。而反 應所利用的光強度,其對反應數率式的貢獻約為 0.622 階,根據上述對反應階數的探討,本實驗使 用之紫外光光強度雖屬低光強度範圍,未達光飽 和的階數 (n=1),但能有接近光飽和的可能;以 下式為氣相丙酮在本反應系統內的反應速率表示 式以實際反應參數表示:

$$-r_{A} = 0.0534 \cdot I^{0.622} \cdot \frac{0.00683 \cdot C_{A}}{1 + 0.00683 \cdot C_{A}} \frac{2.12 \times 10^{-4} \cdot C_{O_{2}}}{1 + 2.12 \times 10^{-4} \cdot C_{O_{2}}} \quad (5)$$

因此,將推導求得出的反應速率常數、丙酮 吸附平衡常數、氧分子吸附平衡常數及紫外光光 強度階數代入原反應速率式,來模擬不同氣體含 氧量及滯留時間下丙酮的去除情形,其模擬結果 如圖 6 及圖 7 所示。結果顯示模擬效果頗佳,故 此模式有相當的合理性,能有效的預測丙酮在本 實驗系統光催化分解的情形。



圖6 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,在不同滯 留時間下,反應物種實際去除情形與理 論模擬結果之比較



圖7 以UV/TiO2程序處理氣相丙酮,在不同含 氧量下,反應物種實際去除情形與理論 模擬結果之比較

四、結論

由本研究結果發現,以紫外線/二氧化鈦程 序處理含氣相丙酮氣體,其反應去除及礦化效果 主要受到反應物初始濃度、紫外線光強度、滯留 時間、氣體含氧量等操作因子的影響,針對整體 反應物的去除及礦化效果而言,在低初始濃度 時,反應速率隨著初始濃度的增加而增加,當反

應物初始濃度大於一定值後,反應速率隨著初始 濃度增加而減少,當反應物初始濃度過高時,反 應的進行受限於觸媒表面上活性吸附位置的數 量,因此初始濃度的增加並不會使反應物吸附於 觸媒上的數量也隨之增加,有一最佳初始濃度 值。隨著紫外光光強度提高,去除率和礦化率呈 現增高的趨勢,但在高光強度時(35mW/cm²),有 逐漸減緩的趨勢,因光觸媒受紫外光激發所產生 的電子-電洞對數目過多,而電子電洞發生重組的 機率也因此相對提高,且在活性位置數量固定的 情況下,所能吸附的反應物數量固定,因此在高 光強度時,增加紫外光光強度對反應並無顯著的 促進效果。滯留時間增加,去除及礦化效果也隨 之愈高,但在長滯留時間時(>350秒),有逐漸減 緩的趨勢。當氣體含氧量較低時,反應速率會隨 著氣體含氧量增加而增加,但在高含氧量時 (>150,000ppmv),則趨於穩定,不再增加,因為在 高含氧量時,吸附於光觸媒表面上的氧會達到飽 和。

参考文獻

- Obee, T. N., Photooxidation of Sub-Parts-per-Million Toluene and Formaldehyde Levels on Titania Using a Glass-Plate Reactor, *Environ. Sci. Technol.*, Vol30, pp.3578-3584 (1996)
- 馬志明, "以紫外線/二氧化鈦程序處理氣相三 氯乙烯污染物反應行為之研究",國立台灣科 技大學化學工程技術研究所碩士論文 (1998)
- Fox, M. A., Aldel-Wahab, A. A., Kim, Y. S., and Dulay, M. J., "Photocatalytic Oxidation of Multifunctional Organic Molecules : The Effect of an Intramolecular Aryl Thioether Group on Semiconductor-Mediated Oxidation/Dehydrogenation of a Primary Aliphatic Alcohol," J. Catal., Vol.126, pp.693-696 (1990)
- 江立偉, "以紫外線/光觸媒程序處理空氣中 苯、甲苯及二甲苯氣體之反應行為",國立台 灣科技大學化學工程學系碩士論文(1999)
- 5. Ollis, D. F., "Photoreactors for Purification and

Decomposition of Air," The 1st International Conference on TiO₂ Photocatalytic and Treatment of Water and Air, London, Ontario, Canada, pp.481-494 (1992)

 Jacoby, W. A., Blake, D. M., Noble, R. D., and Koval, C. A., "Kinetics of the Oxidation of Trichloroethylene in Air via Heterogeneous Photocatalysis," *J. Catal.*, Vol.157, pp.87-96 (1995)